JSR技術セミナー

日時：2024年10月3日木曜日　15-17時

場所：東京大学武田先端知ビル102号セミナー室(浅野キャンバス)、ハイブリッド開催

共催：「東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 JSR・東京大学協創拠点CURIE」

「東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター」

プログラム

15:00 ご挨拶

三田 吉郎

東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター

基盤デバイス研究部門　部門長

東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻　教授

長谷川 公一

JSR・東京大学協創拠点CURIE　室長

JSR株式会社　RDテクノロジー・デジタル変革センター

15:20 「半導体微細化の歴史とレジストの役割　～露光技術とレジストの相補的歩み～」

島 基之

JSR株式会社　執行役員

要旨：半導体は、微細化により大幅な性能向上を達成し、インターネット社会の基盤技術として貢献しています。微細化は露光波長の短波長化と露光技術に適したフォトレジスト開発の両輪で進展してきました。本講演では半導体における微細化の意義を議論しながら、微細化技術のカギとなるフォトリソグラフィ・フォトレジスト技術をわかりやすく解説します。

16:40 質疑応答

16:55 閉会挨拶

小西 邦昭

東京大学大学院理学系研究科フォトンサイエンス研究機構　准教授

※終了後、懇談会を予定しております。

参加申し込み: <https://forms.gle/wk7SnBbN7iWHyaS26>

申し込み締め切り：★ 現地参加 ／ 現地参加＋懇談会　9月26日木曜日

　　　　　　　　　★ オンライン参加　　　　　　　　10月1日火曜日

　　問合せ先: [nanotech@sogo.t.u-tokyo.ac.jp](mailto:nanotech@sogo.t.u-tokyo.ac.jp)

以上